

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年3月3日 (03.03.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/019299 A1

(51)国際特許分類:

C08G 59/40

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(21)国際出願番号:

PCT/JP2004/011848

(22)国際出願日:

2004年8月18日 (18.08.2004)

(25)国際出願の言語:

日本語

(26)国際公開の言語:

日本語

(30)優先権データ:

特願2003-297165 2003年8月21日 (21.08.2003) JP
特願2004-099100 2004年3月30日 (30.03.2004) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 旭化成ケミカルズ株式会社 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒108440 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 Tokyo (JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 宮崎 久遠 (MIYAZAKI, Kuon) [JP/JP]; 〒2330007 神奈川県横浜市港南区大久保3-40-1, B-408 Kanagawa (JP). 高橋 秀明 (TAKAHASHI, Hideaki) [JP/JP]; 〒1120001 東京都文京区白山4-16-16 Tokyo (JP).

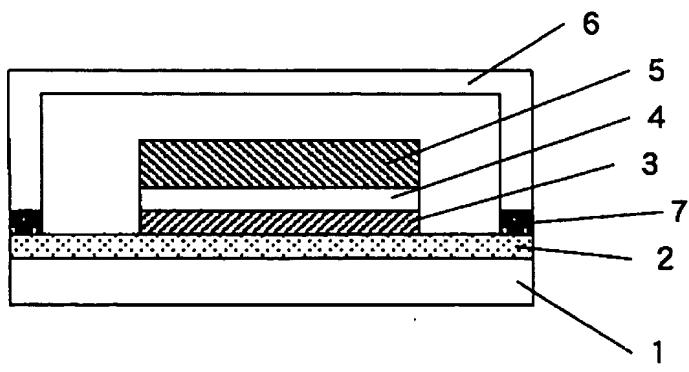
(84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54) Title: PHOTORESITIVE COMPOSITION AND CURED PRODUCT THEREOF

(54)発明の名称: 感光性組成物およびその硬化物



(57) Abstract: A photosensitive composition with excellent photocuring properties is disclosed which contains certain amounts of an epoxy compound having two or more epoxy groups, a polynuclear phenol compound having a specific structure and an energy beam-sensitive cation polymerization initiator, and further if necessary, a hydroxyl group-containing compound having one or more hydroxyl group and one or more of at least either of vinyl ether group and oxetanyl group. A cured film of such a photosensitive composition is excellent in adhesion to various bases, water resistance and flexibility. Also disclosed is a cured product of such a photosensitive composition.

(57)要約: エポキシ基を2個以上有するエポキシ化合物、特定の構造を有する多核フェノール化合物、およびエネルギー線感受性カチオン重合開始剤、さらに必要に応じて分子中に水酸基を1個以上とビニルエーテル基またはオキセタニル基の少なくともどちらか一方を1個以上有する水酸基含有化合物を所定の割合で含有する、光硬化性に優れ、その硬化膜が、種々の基材に対する接着性、耐水性、および屈曲性に優れる感光性組成物およびその硬化物。

WO 2005/019299 A1